

会社案内

Metal Organic Chemical Vapor Deposition



TNCSE
TAIYO NIPPON SANSO GROUP



大陽日酸CSE株式会社
〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町6-2
大陽日酸京浜事業所内
Tel : 044-288-5791
Fax : 044-270-5567



大陽日酸CSE
TAIYO NIPPON SANSO GROUP

経営理念

MOCVD装置のパイオニアとして最高の技術で産業と社会に貢献する。

MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition, 有機金属気相成長法)は化合物半導体の薄膜の結晶を成長させる方法です。化合物半導体は発光ダイオード、半導体レーザーのように光を発する固体光源 及び 超高速トランジスタに用いられています。

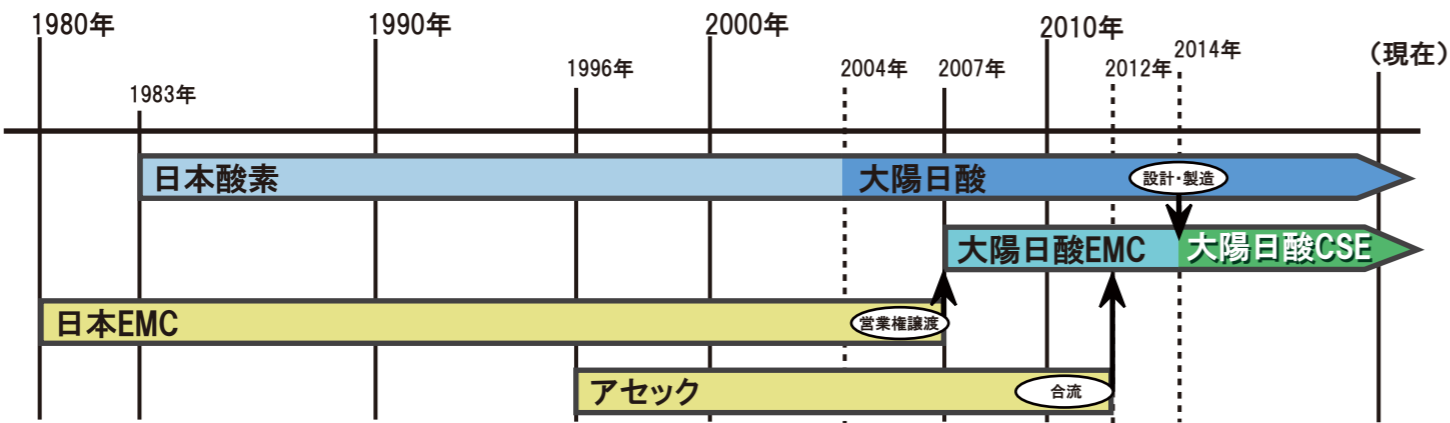
会社概要

商号 : 大陽日酸CSE株式会社
 本社 : 神奈川県川崎市川崎区小島町6番地2(大陽日酸京浜事業所内)
 代表取締役社長 : 山崎 利明
 創業 : 2008年2月1日
 資本金 : 1,000万円
 株主 : 大陽日酸株式会社(100%出資子会社)
 事業内容 : 化合物半導体製造装置および関連装置の設計製造、エンジニアリング業務、メンテナンス業務
 販売先 : 大陽日酸株式会社
 認証取得 : ISO9001



沿革

日本のMOCVD装置メーカー主要三社が統合して大陽日酸CSEが生まれました。



- 1980年 ㈱日本イー・エム・シー設立、MOCVD製造装置製造販売開始
- 1983年 日本酸素㈱でMOCVD装置事業開始
- 1996年 ㈱アセック設立
- 2004年 日本酸素㈱と大陽東洋酸素㈱が合併し、大陽日酸㈱に商号変更
- 2007年 ㈱日本イー・エム・シーから大陽日酸イー・エム・シー(株)へMOCVD装置事業を譲渡
- 2008年 大陽日酸㈱の完全子会社として大陽日酸イー・エム・シー(株)創業
- 2012年 大陽日酸イー・エム・シー(株)と㈱アセックのMOCVD装置事業が合流
- 2014年 大陽日酸㈱化合物事業部の設計製作部門と統合し、社名を大陽日酸イー・エム・シー(株)から大陽日酸CSE(株)に変更、本社を移転



大陽日酸京浜事業所



大陽日酸つくば研究所

製品ラインナップ

研究用MOCVD装置

GaAs系、InP系: VR、HR、BRCシリーズ
 GaN系: SR、GRCシリーズ

量産用MOCVD装置

GaAs系、InP系: HR、PR、BMCシリーズ
 GaN系: SR、UR、GMCシリーズ

HVPE装置

GaAs系、InP系、GaN系

ドライ洗浄装置

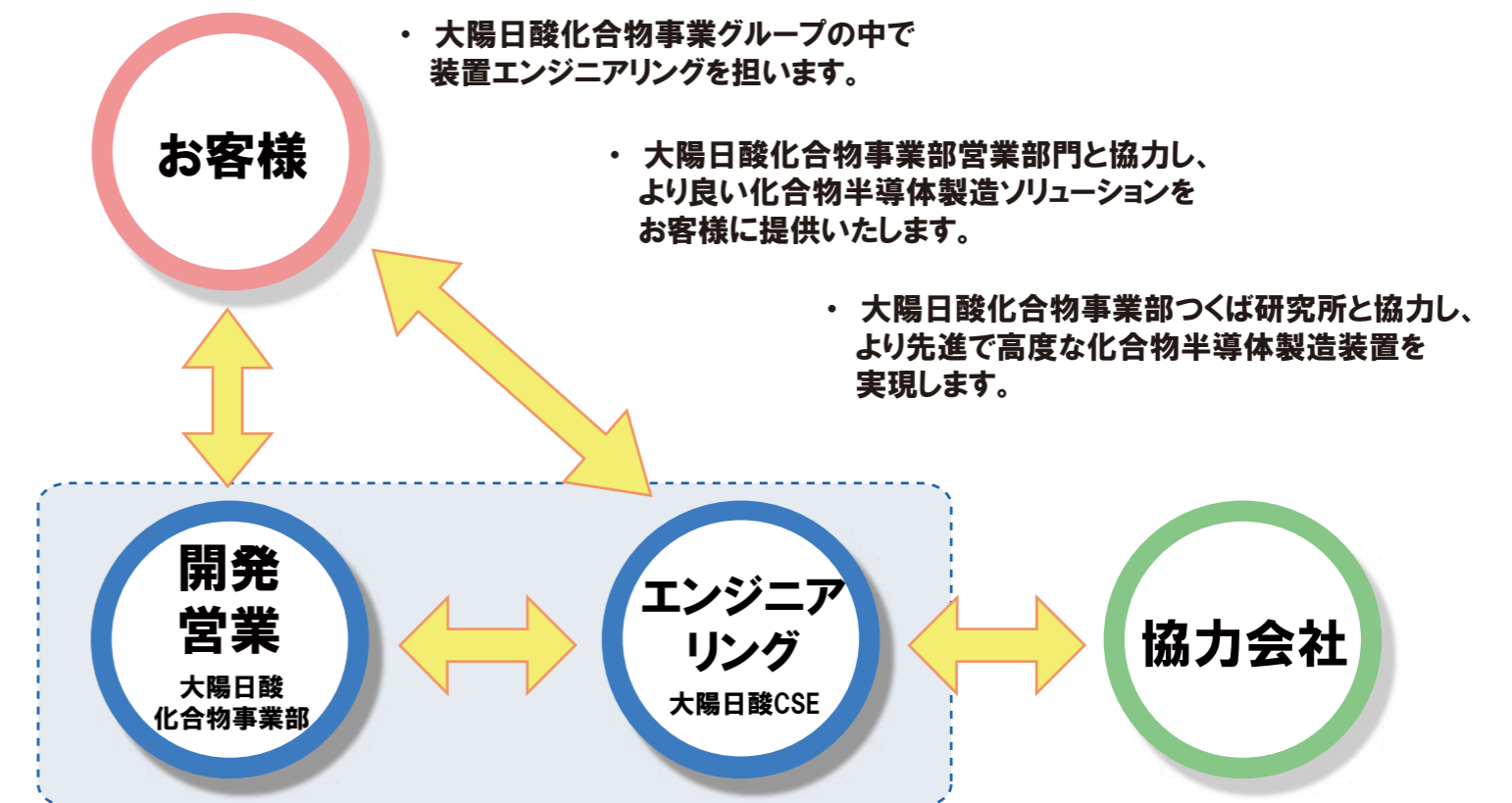
GaN系: DEXシリーズ

MOCVD装置関連製品

特殊CVD装置(SiC等)、不純物拡散装置、等々

大陽日酸グループは、量産用大型機から研究開発用小型機までのあらゆるニーズに対応できるMOCVD装置をラインナップしています。また、研究開発用小型機においては、お客様の研究開発目的に応じた特殊仕様のMOCVD装置についても対応させていただいております。さらに、ハイドライド気相成長(HVPE)装置やドライ洗浄装置。特殊なCVD関連装置についても提供させていただいております。

大陽日酸CSEの位置づけ



UR25K



UR26K



クリーンルーム